

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 2 部門第 4 区分  
【発行日】平成26年8月21日(2014.8.21)

【公開番号】特開2013-188970(P2013-188970A)  
【公開日】平成25年9月26日(2013.9.26)  
【年通号数】公開・登録公報2013-052  
【出願番号】特願2012-57668(P2012-57668)  
【国際特許分類】

**B 4 1 J 2/135 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/045 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/055 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 3 N

B 4 1 J 3/04 1 0 3 A

【手続補正書】  
【提出日】平成26年7月7日(2014.7.7)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】請求項 5  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【請求項 5】

前記結晶異方性エッチング工程では、前記第 2 シリコン基板が前記第 1 シリコン基板を結晶異方性エッチングする際のエッチングストッパとして機能する請求項 1 から 4 のいずれか 1 項記載のノズルプレートの製造方法。